

☆条件出し・装置対応・トラブル解決!実務直結のノウハウを一日で習得!

スパッタ・蒸着・CVDによる薄膜形成技術の基礎とトラブル対策

<https://www.rdsc.co.jp/seminar/251277>

- ◆開催日時：2025年12月04日（木） 10:00～17:00
◆開催形式：LIVE受講 or アーカイブ受講（視聴期間：12/5～12/12）
◆受講料：1名につき57,200円（税込、資料付）
※会員登録（無料）をしていただいた方には下記の割引・特典を適用します。
・1名でお申込みされた場合、1名につき49,500円（税込）
・2名同時でお申し込みされた場合、2人目は無料（2名で57,200円（税込））

セミナーお申込みFAX

03-5857-4812

※お申込み確認後は弊社よりご連絡いたします。

●講師：三重大学 大学院工学研究科 電気電子工学専攻 教授 博士（工学） 佐藤 英樹 氏

【講座の趣旨】

スパッタ法や真空蒸着法、化学気相成長（CVD）法は、先端材料研究をはじめ、電子デバイス、太陽電池、建材、さらには食品産業まで、さまざまな分野で使用されており、今や我々の生活と切っても切り離せない技術になっています。エレクトロニクスや真空技術の進歩により、現在では高性能な成膜装置が市販されていますが、これらを使いこなすには適切な知識が必要です。たとえば、新たな条件で成膜を行おうとすると、所望の薄膜を得るために条件出しを行わなければなりません。また、成膜プロセスでトラブルが発生すると、その対処に頭を悩ませることになります。そのようなときに必要になるのが、成膜技術に関する基本的かつ系統的な知識です。

本講座では、真空蒸着法やスパッタ法、CVD法などを用いた成膜技術に携わる方々を対象に、これらの技術に関する基礎的かつ系統的な知識を習得し、実際の業務に生かして頂くことを目標とします。

【プログラム】

1. 成膜技術に必要な真空・表面物性工学

- 1-1. 気体分子運動論の基礎
- 1-2. 真空工学の基礎
- 1-3. 表面物性工学の基礎

2. 真空蒸着法

- 2-1. 真空蒸着法の原理

- 2-2. 真空蒸着法の種類と装置例

- 2-3. 真空蒸着法で作製される薄膜の例

- 2-4. 真空蒸着法を適用する際の留意事項

3. スパッタ法

- 3-1. スパッタ法の原理

- 3-2. スパッタ法の種類と装置例

- 3-3. スパッタ法で作製される薄膜の例

- 3-4. スパッタ法を適用する際の留意事項

4. 化学気相成長（CVD）法

- 4-1. CVD法の原理

- 4-2. CVD法の種類と装置例

- 4-3. CVD法で作製される薄膜の例

- 4-4. CVD法を適用する際の留意事項

5. 薄膜評価法

- 5-1. 表面モルフォロジ、ステップカバレージ

- 5-2. 膜組成、膜構造

- 5-3. 付着力、膜応力

- 5-4. 電気的特性、光学的特性

6. 成膜プロセスで遭遇するトラブル例と対処法

- 6-1. 膜質に関するトラブル

- 6-2. 装置に関するトラブル

『薄膜』セミナー申込書 ※ご希望の参加形式にチェックを入れて下さい⇒☐LIVE ☐アーカイブ

会社・大学			
住所	〒		
電話番号		FAX	

お名前	所属・役職	E-Mail
①		
②		

会員登録（無料） ※案内方法を選択してください。複数選択可。

☐Eメール ☐郵送

● セミナーの受講申込みについて ●

必要事項をご明記の上、FAXでお申込み下さい。弊社で確認後、必ず受領のご連絡をいたします。受講用URLは後日お送りいたします。

セミナーお申込み後のキャンセルは基本的にお受けしておりませんので、ご都合により出席できなくなった場合は代理の方がご出席ください。

お申込み・振込に関する詳細はHPをご覧ください。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/entry>

個人情報保護方針の詳細はHPをご覧ください。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/privacy>